

第4回

WORKSHOP

EUV-FEL

先端加速器技術の産業展開
～半導体の更なる微細加工に向けて～

参加費
無料
定員120名

2019 **12.10** 火 開場 12:30-
13:00-17:05

基調講演



Tadatake Sato



Soichi Inoue

Web
申込先



申込み締切
12月4日 **水** まで

<https://conference-indico.kek.jp/indico/event/93/>

開催場所



秋葉原UDX 4F
NEXT1
東京都千代田区外神田 4-14-1

<https://udx-akibaspace.jp/gallery-n/>

お問合せ

高エネルギー加速器研究機構
EUV-FELworkshop事務局
E-mail. euv-ws@ml.post.kek.jp

Program

基調講演

産業界への波及を目指す新波長域レーザー技術開発

R&D on new lasers with unexplored wavelengths aiming at industrial application

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
電子光技術研究部門・先進レーザープロセスグループ 研究グループ長

Tadatake Sato 佐藤正健

先端半導体とパターニング技術の現状と今後

Trend of Leading-Edge Semiconductors and the Patterning Technologies

キオクシア(株) メモリ技術研究所 プロセス技術研究開発センター 技監

Soichi Inoue 井上壮一

一般講演

cERLを用いた高繰り返しFELの実証とEUV-FELのその先
高エネルギー加速器研究機構 加藤龍好

レジスト材料の軟X線FEL光照射に関する研究

大阪大学 岡本一将

リソグラフィ応用光源(DUV/EUV)の最近の進展

ギガフォトン株式会社 溝口計

超伝導高周波加速器の低コスト化と次世代技術

高エネルギー加速器研究機構 道園真一郎



主催：EUV-FEL 光源産業化研究会、高エネルギー加速器研究機構